

界面コロイドラーニング

ー 第31回現代コロイド・界面化学基礎講座 ー
(東京会場)

2015.5.14(木)–15(金)

日本化学会館

最先端のコロイドの知識を
充実した2日間で。

界面・コロイド化学は、洗剤・化粧品・塗料など日常生活に密着した製品から、医療材料・医薬品、最先端の電子部品用材料まで、さまざまな工業製品開発において重要な役割を果たしています。本講演会は、特に若手社員や新たにこの分野の知識を必要とされる方々に、界面・コロイド化学を基礎から学んでいただくための集中講義です。この2日間でコロイド・界面化学の基礎を一通り習得できます！本講座は今年で31回目にもなる実績のある講座です。東京・大阪とご都合のよい日程と会場でご参加ください。充実した講師との交流会・質問タイムも毎年好評です。

講座の
特長

短期集中！

界面・コロイドの幅広い基礎を、2日間で効率的に学べます。

豪華な講師陣！

豊富な研究実績や教育経験をもつ充実した講師陣が講義します。

充実の質問時間！

ふんだんに設けられた講師への質問時間と交流会がより深い理解へとつながります。

❖ プログラム

※参加者の方には丸善『第3版現代界面コロイド化学の基礎-原理・応用・測定ソリューション』を配布します。

<Day 1>

10:00–11:20	コロイド・界面科学ー表面張力と表面積が織りなす世界ー	辻井 薫 (中央大学)
11:30–12:40	基礎からの界面活性剤 ー 昼食・質問コーナー ー	近藤 行成 (東京理科大学)
13:30–14:40	有機・無機ナノ粒子の製法と基礎物性	蟹江 澄志 (東北大学)
14:50–16:00	微粒子分散系の分散・凝集の基礎	武田 真一 (武田コロイドテクノ・コンサルティング㈱)
16:10–17:20	固体表面での現象	飯山 拓 (信州大学)

<Day 2>

9:40–10:50	乳化の基礎	岡本 亨 (資生堂㈱)
11:00–12:10	界面活性剤多成分溶液系における相図の見方と製剤への応用 ー 昼食・質問コーナー ー	鈴木 敏幸 (㈱コスモステクニカルセンター)
13:00–14:10	洗浄の基礎と応用	田村 隆光 (工業所有権協力センター)
14:20–15:30	高分子の界面化学	松岡 秀樹 (京都大学)
15:40–16:50	生体膜系における界面コロイド科学	秋吉 一成 (京都大学)
17:00–18:10	レオロジーなんかこわくない！：レオロジー入門	上田 隆宣 (上田レオロジー評価研究所)

会場：日本化学会館（東京都千代田区 神田駿河台 1-5）

<http://www.chemistry.or.jp/access/index.html>

❖ 参加費・お申込み

部会員 30,000 円、日化・協賛学会員 35,000 円、非会員 40,000 円、学生 10,000 円

※ご勤務先が法人部会員の場合は部会員、日本化学会法人会員の場合は日本化学会会員、協賛学会法人会員の場合は協賛学会会員扱いとなります。

■ 参加ご希望の方は、コロイドおよび界面化学部会 Web サイト (<http://colloid.csj.jp>) からお申込み下さい。

■ 参加費は銀行振込または郵便振替にて、事前にお支払い下さい。

銀行振込先：みずほ銀行神田支店 普通 1073505 公益社団法人日本化学会

郵便振替番号：00170-0-6058（通信欄に「界面コロイドラーニング参加費」と明記して下さい）

❖ お問い合わせ

(公社)日本化学会 コロイドおよび界面化学部会

〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台 1-5 Phone: (03)3292-6163 FAX: (03)3292-6318 e-mail: dcsc@chemistry.or.jp